

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013 年 1 月 17 日(17.01.2013)



(10) 国際公開番号

WO 2013/008912 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/40 (2006.01) H01L 21/027 (2006.01)
C08F 226/02 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2012/067926
- (22) 国際出願日: 2012 年 7 月 13 日(13.07.2012)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2011-155822 2011 年 7 月 14 日(14.07.2011) JP
- (71) 出願人 (アルバニア, オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェッコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, 英国, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リトアニア, ルクセンブルグ, ラトヴィア, モナコ, マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国, マルタ, オランダ, ノールウェー, ポーランド, ポルトガル, カタール, ルーマニア, セルビア, ルワンダ, スウェーデン, スロヴェニア, スロヴァキア, サン・マリノ, トルコ, 米国を除く全ての指定国について): AZ エレクトロニックマテリアルズ IP 株式会社 (AZ Electronic Materials IP (Japan) K.K.) [JP/JP]; 〒1130021 東京都文京区本駒込 2 丁目 2 番 8 号 文京グリーンコート Tokyo (JP).
- (71) 出願人 (アルバニア, オーストリア, ベルギー, ブルガリア, スイス, キプロス, チェッコ, ドイツ, デンマーク, エストニア, スペイン, フィンランド, フランス, 英国, ギリシャ, クロアチア, ハンガリー, アイルランド, アイスランド, イタリア, リトアニア, ルクセンブルグ, ラトヴィア, モナコ, マケドニア旧ユーゴスラヴィア共和国, マルタ, オランダ, ノールウェー, ポーランド, ポルトガル, ルーマニア, セルビア, スウェーデン, スロヴェニア, スロヴァキア, サン・マリノ, トルコについてのみ): AZ エレクトロニックマテリアルズ USA コーポレーション (AZ Electronic Materials USA CORP.) [US/US]; 08876 ニュージャージー州サマーヴィル マイスターアベニュー 70 New Jersey (US).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 岡村 聡也 (OKAMURA Toshiya) [JP/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜 3 3 3 0 AZ エレクトロニックマテリアルズマニュファクチャリング株式会社内 Shizuoka (JP). ポロウスキー ゲオルク (PAWLOWSKI Georg) [DE/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜 3 3 3 0 AZ エレクトロニックマテリアルズマニュファクチャリング株式会社内 Shizuoka (JP). 石井 雅弘 (ISHII Masahiro) [JP/JP]; 〒4371412 静岡県掛川市千浜 3 3 3 0 AZ エレクトロニックマテリアルズマニュファクチャリング株式会社内 Shizuoka (JP).
- (74) 代理人: 勝沼 宏仁, 外 (KATSUNUMA Hirohito et al.); 〒1000005 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号 富士ビル 3 2 3 号 協和特許法律事務所 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: COMPOSITION FOR FORMING FINE PATTERN AND METHOD FOR FORMING FINED PATTERN USING SAME

(54) 発明の名称: 微細パターン形成用組成物およびそれを用いた微細化されたパターン形成方法

(57) Abstract: [Problem] To provide a composition for fine pattern formation which can form a resist pattern having high etching resistance and a method for forming a resist pattern using the composition. [Solution] A composition for fine pattern formation which comprises both a water-soluble resin having an aromatic-containing substituent as a side chain and pure water. This composition contains acid groups bonded to the water-soluble resin or contains a free acid therein.

(57) 要約: [課題] 高いエッチング耐性を有するレジストパターンを形成させることのできる微細パターン形成用組成物、およびそれを用いたレジストパターンの形成方法の提供。 [解決手段] 側鎖に芳香族含有置換基を有する水溶性樹脂と純水とを含む微細パターン形成用組成物。この組成物は、水溶性樹脂に結合した酸基を含むか、または組成物中に遊離の酸を含んでいる。



WO 2013/008912 A1